

# SWC-3000兆声晶圆清洗机

产品名称	SWC-3000兆声晶圆清洗机
公司名称	上海耀他科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那诺-马斯特 型号:SWC-3000 产地:美国
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号6幢101室JT4602 (注册地址)
联系电话	021-62318025 17317363700

## 产品详情

SWC-3000兆声晶圆（掩模版）清洗机概述：

兆声和清洗技术的发展，对MEMS和半导体等领域的晶圆和掩模版清洗提供了的水平，可以帮助用户获得z干净的晶圆片和掩模版。

NANO-MASTER提供兆声单晶圆&掩模清洗(SWC)系统，用于的无损兆声清洗。可以适用于易受损的带图案或无图案的基片，包含带保护膜的掩模版。为了确保不损伤基片的情况下达到\*化的清洗效果，兆声能量的密度必须保持在稍稍低于样片上任意位置上的损伤阈值。NANO-MASTER的技术确保了声波能量均匀分布到整个基片表面，通过分布能量的z大化支持z理想的清洗，同时保证在样片的损伤阈值范围内。

SWC系统提供了可控的化学试剂滴胶能力，这使得颗粒从基片表面的去除能力得以进一步加强。SWC和LSC具备对点试剂滴胶系统，可以\*节省化学试剂的用量的。滴胶系统支持可编程的化学试剂混合能力，提供了可控的化学试剂在整个基片上的分布。

SWC-3000兆声晶圆（掩模版）清洗机应用：

带图案或不带图案的掩模版和晶圆片

Ge, GaAs以及InP晶圆片清洗

CMP处理后的晶圆片清洗

晶圆框架上的切粒芯片清洗

等离子刻蚀或光刻胶剥离后的清洗

带保护膜的分划版清洗

掩模版空白部位或接触部位清洗

X射线及极紫外掩模版清洗

光学镜头清洗

ITO涂覆的显示面板清洗

兆声辅助的剥离工艺

特点：

台式系统

无损兆声掩模版或晶圆片清洗及旋转甩干

支持12"直径的圆片或9" x9"方片

微处理机自动控制

IR红外灯

选配项：

掩模版或晶圆片夹具

PVA软毛刷清洗

化学试剂清洗(CDU)

氮气离子发生器

我公司主要经营各类真空镀膜微纳加工设备，包括薄膜沉积、刻蚀及清洗去胶设备等（ALD，PECVD，RIE，磁控溅射，热蒸镀，电子束，离子束，热真空试验，晶圆清洗机，PA-MOCVD）